(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
H01L 21/302

(11) 공개번호 특1997-0077237
(43) 공개일자 1997년12월12일

(21) 출원번호 특1996-0014674
(22) 출원일자 1996년05월06일

(71) 출원인 삼성전자 주식회사 김광호
경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지
(72) 발명자 맹호섭
경기도 부천시 중구 약대동 163-5

심사청구 : 없음

(54) 반도체소자 제조용 플라즈마 식각장치

요약

본 발명은 반도체소자의 제조공정에 사용되는 건식식각 장치에 관한 것으로, 특히 플라즈마를 이용한 건식공정중 웨이퍼가 안착되는 플레이트의 오염을 방지하여 공정의 균일도를 높일 수 있도록 한 플라즈마를 이용한 건식식각 장치에 대한 것으로, 본 발명의 실시예에 따른 건식식각정치는 웨이퍼가 안착되는 에노드를 구비하고, 상기 애노드의 중심에 상기 웨이퍼가 삽입되는 홈을 포함하여, 종래에 에칭시 발생하는 폴리머로 인하여 발생되는 웨이퍼의 정렬에 따른 에칭의 불균일과 웨이퍼의 로딩 및 언로딩시 웨이퍼의 미끄러짐을 방지하므로서 공정의 균일도와 아울러 수율을 높일 수 있도록 한 것이다.

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

반도체소자 제조용 플라즈마 식각장치

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명에 따른 애노드의 구조도

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

웨이퍼가 안착되는 애노드를 구비한 반도체소자 제조용 플라즈마 식각장치에 있어서, 상기 애노드의 중심에 상기 웨이퍼가 삽입되는 홈이 형성된 것을 특징으로 하는 반도체소자 제조용 플라즈마 식각장치.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 홈의 바닥은 평탄면을 갖도록 한 것을 특징으로 하는 반도체 제조용 플라즈마 식각장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면3

